

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации Каланова Дмитрия Валерьевича «Радиационные эффекты в неравновесной плазме дуговых и тлеющих разрядов», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.08 – физика плазмы.

Смирнов Александр Сергеевич

Ученая степень: доктор физико-математических наук

Ученое звание: профессор

Специальность: 01.04.08 – физика плазмы

Место работы, должность: Санкт-Петербургский Политехнический Университет им. Петра Великого, кафедра физики плазмы ИФНиТ, профессор

Почтовый адрес: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

Телефон: +7 (921) 581-01-99

Основные публикации:

1. А. А. Кудрявцев, А. С. Смирнов, Л. Д. Цендин, **Физика тлеющего разряда**, СПб.: ЛАНЬ, 2009.
2. K. E. Orlov, D. A. Malik, I.V. Miroshnikov, A. S. Smirnov, **Spatial and temporal evolution of a dielectric barrier discharge**, *Journal of Applied Physics*, 103, #3, 033303-033307-7, 2008.
3. A. Ya. Vinogradov, A. S. Abramov, K. E. Orlov, A. S. Smirnov, **PECVD of hard carbon films under low substrate temperature conditions**, *Vacuum*, 73 pp. 131—135, 2004.
4. K. E. Orlov, D. A. Malik, T. V. Chernoziumskaya, A. S. Smirnov, **RF Electrode Sheath Formation near a Concave Electrode**, *Phys. Rev. Lett.* 92, 055001, 2004.
5. K. E. Orlov, A. S. Smirnov, **Observation of a plasma-sheath resonance in a parallel-plate low-pressure RF discharge**, *Plasma Sources Science and Technology*, 10, #8, p. 541—546, 2001.
6. K. E. Orlov, A. S. Smirnov. **Gamma-electron dynamics and radio frequency capacitive sheath diagnostics**. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 27, #5, p.1348—1352, 1999.
7. K. E. Orlov, A. S. Smirnov. **Calculation of discharge parameters in low-pressure diode-type radio frequency noble gas plasmas**. *Plasma Sources Science and Technology*, 8, #1, p. 37—48, 1999.
8. A.I.Kosarev, A. S. Abramov, A. Ya. Vinogradov, M.V. Shutov, A. S. Smirnov. **Effect of Ion Bombardment in VHF Glow Discharge on Growth and Properties of SiHx Films**. *J. Vac. Sci. Technol. A*, 15, p. 298—306, 1997.